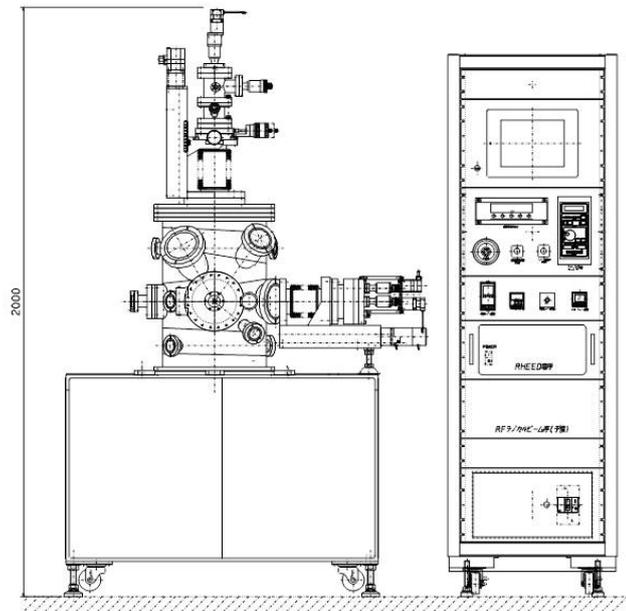




型号: PLD-202-2

脉冲激光沉积系统

Pulsed Laser Deposition System



设备的详细指标及配置欢迎来电咨询

设备名称	脉冲激光沉积系统(标准型, 陶瓷加热)	备注
型号	PLD-202-2	
概要	镀膜室尺寸: 340 (ID) X 500 (H) mm	电解抛光、外缠加热丝
	自公转靶: ϕ 1英寸 5个 (相互之间防污染)	尺寸数量可调整
	衬底加热: 抗氧化型陶瓷加热器、温度1200	其它加热形式可选择
	衬底: ϕ 1英寸, 温度高于900, 5轴位移台	根据需要尺寸可以调整
	镀膜室真空度: 小于 5×10^{-6} Pa	可选择抽气方式
	工作气体: 2路、质量流量计控制	根据需要可调整
	选配仪器: 准备室, RHEED及图像处理软件, 活化离子源, 红外温度仪, 镀膜软件等	根据需要选配
尺寸及电源	尺寸: 150 (长) X 120 (宽) X 200 (高) CM 电源: 单相 220V 60A	

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD.
 TEL: 06-6707-5888 E-mail: info@anseitech.com